

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(10) 国際公開番号

WO 2011/118319 A1

PCT

(43) 国際公開日
2011 年 9 月 29 日(29.09.2011)

- (51) 国際特許分類:
B01J 2/00 (2006.01) C08L 101/00 (2006.01)
C01B 33/18 (2006.01) H01L 21/56 (2006.01)
C08K 9/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/053914
- (22) 国際出願日: 2011 年 2 月 23 日(23.02.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-071116 2010 年 3 月 25 日(25.03.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 住吉 孝文 (SUMIYOSHI Takafumi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 柴田 洋志 (SHIBATA Hiroshi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品

川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 朝比 一夫, 外 (ASAHI Kazuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 1 丁目 1 8 番 9 号 西新橋ノアビル 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: APPARATUS FOR PRODUCTION OF PARTICLES, PROCESS FOR PRODUCTION OF PARTICLES, AND PROCESS FOR PRODUCTION OF RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR SEALING PURPOSES

(54) 発明の名称: 粒子製造装置、粒子製造方法および半導体封止用樹脂組成物の製造方法

[図2]

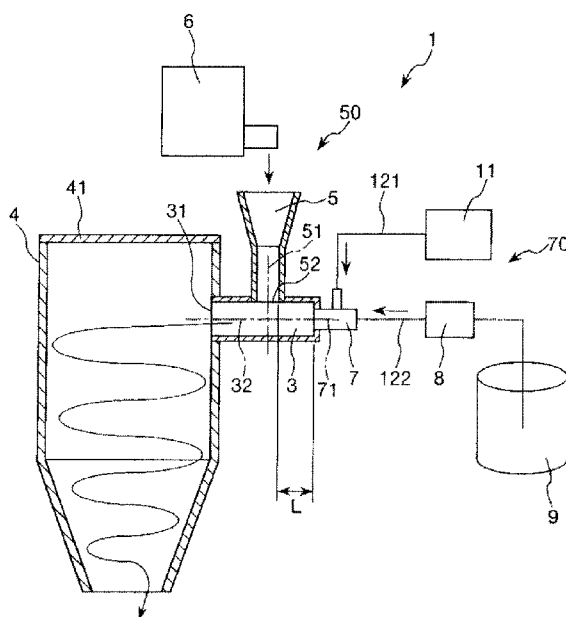


FIG.2

(57) Abstract: Disclosed is an apparatus (1) for producing particles, which comprises: a treatment vessel (3) in which a treatment solution is adhered onto the surfaces of inorganic particles; a chamber (4) which is communicated with a downstream side of the treatment vessel (3) and in which a powdery material and air are separated from each other; a powdery material supply means (50) which comprises a supply section (5), a supply system (6) and the like and enables the supply of the powdery material to the treatment vessel (3); and a treatment solution spray means (70) which comprises a nozzle (7), a pump (8), a supply system (9), a high-pressure air generation system (11) and the like and enables the spraying of the treatment solution in the form of droplets onto the powdery material that has been just supplied into the treatment vessel (3). The treatment vessel (3) preferably has a smaller volume than that of the chamber (4).

(57) 要約: 粒子製造装置 1 は、無機粒子の表面に処理液を付着させる処理室 3 と、処理室 3 の下流側に連通し、粉末材料と空気とを分離するチャンバ 4 と、供給部 5 および供給装置 6 等を有し、処理室 3 内に粉末材料を供給する粉末材料供給手段 50 と、ノズル 7、ポンプ 8、供給装置 9 および高圧空気発生装置 11 等を有し、処理室 3 内に供給された直後の粉末材料に処理液を液滴として噴霧する処理液噴霧手段 70 とを備えている。処理室 3

の容積は、チャンバ 4 の容積よりも小さく設定されていることが好ましい。